

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】平成20年1月31日(2008.1.31)

【公表番号】特表2007-516837(P2007-516837A)

【公表日】平成19年6月28日(2007.6.28)

【年通号数】公開・登録公報2007-024

【出願番号】特願2006-547574(P2006-547574)

【国際特許分類】

B 0 1 J 29/74 (2006.01)

B 0 1 J 29/80 (2006.01)

B 0 1 J 37/20 (2006.01)

C 0 7 C 5/27 (2006.01)

C 0 7 C 15/08 (2006.01)

C 0 7 B 61/00 (2006.01)

【F I】

B 0 1 J 29/74 Z

B 0 1 J 29/80 Z

B 0 1 J 37/20

C 0 7 C 5/27

C 0 7 C 15/08

C 0 7 B 61/00 3 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成19年12月10日(2007.12.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

キシレンとエチルベンゼンの供給原料混合物の異性化のためのプロセスにおいて、異性化ゾーン内で水素の存在下、上記供給原料混合物を触媒と異性化条件下で接触させてC₈環ロスを最低限に抑えつつエチルベンゼンをキシレンに安定的に異性化するステップを含み、上記触媒が元素ベースで計算して0.1～2重量%の白金族成分と、シリカ対アルミナ・モル比が4.5以下であり、1～90重量%の基本的にモルデナイトを含まないMTW型のゼオライト成分と、そして無機酸化物結合材成分とを含んでおり、上記異性化条件が300℃～500℃の範囲の温度と、1～50気圧の圧力と、0.5～10毎時の範囲の液体時間空間速度と、そして水素：炭化水素モル比が0.5：1から2.5：1の範囲であり、供給原料混合物に対するC₈環ロスを4モル%以下に抑えて上記供給原料混合物におけるよりもキシレンの割合を高めた異性化生成物を得ることを特徴とするプロセス。

【請求項 2】

上記触媒がさらに元素ベースで計算して、0.01～5重量%のIVA族（IUPAC 14）成分を含んでいることを特徴とする、請求項 1 記載のプロセス。

【請求項 3】

上記IVA族（IUPAC 14）成分がスズであることを特徴とする請求項 2 記載のプロセス。

【請求項 4】

上記触媒がさらに0.05～1.0重量%の硫黄を含んでいることを特徴とする請求項

1 又は 2 記載のプロセス。

【請求項 5】

上記 M T W 型ゼオライト成分の量が 2 - 2 0 重量%の範囲であることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載のプロセス。

【請求項 6】

上記 M T W 型ゼオライト成分が 2 0 - 4 0 の範囲のシリカ：アルミナ・モル比を有していることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載のプロセス。

【請求項 7】

上記無機酸化物結合材成分がアルミナ及びシリカのうちの 1 つ、あるいは両方を含んでいることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載のプロセス。

【請求項 8】

上記 M T W 型ゼオライト成分のモルデナイト含有量が最大でも 2 0 重量%であることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載のプロセス。